

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2016 年 6 月 30 日(30.06.2016)



(10) 国際公開番号
WO 2016/104723 A1

- (51) 国際特許分類:
G06F 3/041 (2006.01) *H05K 3/20* (2006.01)
H05K 3/12 (2006.01) *H05K 3/38* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2015/086271
- (22) 国際出願日: 2015 年 12 月 25 日(25.12.2015)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2014-264492 2014 年 12 月 26 日(26.12.2014) JP
- (71) 出願人: 株式会社フジクラ (FUJIKURA LTD.)
[JP/JP]; 〒1358512 東京都江東区木場一丁目 5 番
1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 本戸 孝治 (HONDO, Takaharu); 〒2858550
千葉県佐倉市六崎 1 4 4 0 番地 株式会社フジ
クラ 佐倉事業所内 Chiba (JP).
- (74) 代理人: とこしえ特許業務法人 (TOKOSHIE PAT-
ENT FIRM); 〒1600023 東京都新宿区西新宿 7 丁
目 2 2 番 2 7 号 西新宿 K N ビル Tokyo (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユー
ラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨー
ロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

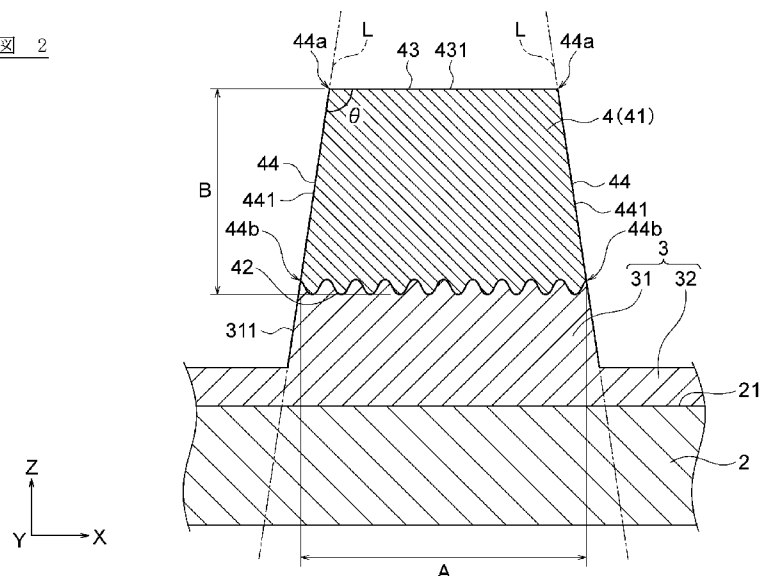
添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: WIRING BODY, WIRING BOARD, TOUCH SENSOR AND METHOD FOR PRODUCING WIRING BODY

(54) 発明の名称: 配線体、配線基板、タッチセンサ、及び配線体の製造方法

図 2



(57) Abstract: This wiring body (1) is provided with a bonding layer (3) and a conductor pattern (41) that is bonded to the bonding layer (3). The surface roughness of a bonding surface (42) of the conductive conductor (41), said bonding surface being bonded to the bonding layer (3), is higher than the surface roughnesses of surfaces other than the bonding surface (42) of the conductor pattern (41).

(57) 要約: 配線体 (1) は、接着層 (3) と、接着層 (3) に接着された導体パターン (41) と、を備えており、導体パターン (41) において接着層 (3) に接着される接着面 (42) の面粗さは、導体パターン (41) において接着面 (42) を除く他の面の面粗さよりも粗くなっている。



WO 2016/104723 A1

明 細 書

発明の名称：

配線体、配線基板、タッチセンサ、及び配線体の製造方法

技術分野

[0001] 本発明は、配線体、配線基板、タッチセンサ、及び配線体の製造方法に関するものである。

文献の参照による組み込みが認められる指定国については、2014年12月26日に日本国に出願された特願2014-264492号に記載された内容を参照により本明細書に組み込み、本明細書の記載の一部とする。

背景技術

[0002] 凹版に導体材料を充填した後、オフセット印刷方法を用いて当該導体材料を被転写基板に転写し、その後の加熱工程を経ることにより形成された導体配線パターンが知られている（例えば特許文献1参照）。

[0003] また、電磁波シールド材として、未硬化の導電性組成物が充填された所定パターンの凹部を有する版面と、その導電性組成物の転写対象である基材の一方の面とを、未硬化のプライマー層を介して圧着して、当該導電性組成物をプライマー層上に転写した後に、当該導電性組成物の硬化処理を行って導電層を形成するものが知られている（例えば特許文献2の[0087]参照）。

先行技術文献

特許文献

[0004] 特許文献1：特開2007-324426号公報

特許文献2：国際公開2008/149969号

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0005] 上記の導体配線パターンや電磁波シールド材の導電層は、導体材料（導電性組成物）の転写後に硬化・加熱処理を行うことにより形成されるため、当

該導体配線パターンの表面には導体材料を構成する導電性粒子に由来する凹凸形状が生じる。このため、外部から入射する光が当該導体配線パターンの表面で乱反射するという問題がある。一方、導体配線パターン全体の表面粗さを小さくして当該乱反射を抑制することができたとしても、導体材料と基板との接着を強固に行うことが困難になるという問題がある。

[0006] 本発明が解決しようとする課題は、絶縁部材と導体パターンとを強固に接着しつつ、外部から入射する光の乱反射を抑制することができる配線体、配線基板、タッチセンサ、及び配線体の製造方法を提供することである。

課題を解決するための手段

[0007] [1] 本発明に係る配線体は、絶縁部材と、前記絶縁部材に接着される導体パターンと、を備え、前記導体パターンにおいて前記絶縁部材に接着される接着面の面粗さは、前記導体パターンにおいて前記接着面を除く他の面の面粗さよりも粗いことを特徴とする。

[0008] [2] 上記発明において、下記(1)式を満たしてもよい。

$$0.5 \leq B/A \cdots (1)$$

但し、上記(1)式において、Aは前記導体パターンの断面視における最大幅であり、Bは前記導体パターンの前記断面視における最大高さである。

[0009] [3] 上記発明において、前記他の面は、前記接着面の反対側に位置する頂辺部を有し、

前記頂辺部は、平坦部を含んでもよい。

[0010] [4] 上記発明において、前記他の面は、前記接着面の反対側に位置する頂辺部と、前記接着面と前記頂辺部との間に位置する側部を有し、前記側部は、断面視において、前記絶縁部材から離れる方向に従い、前記導体パターンの中心に接近するように傾斜してもよい。

[0011] [5] 前記側部は、前記絶縁部材から離れる方向に向かって凸状に形成されていてもよい。

[0012] [6] 上記発明において、前記頂辺部と前記側部との間の角度 θ は、 $90^\circ \sim 120^\circ$ であってもよい。

- [0013] [7] 上記発明において、前記側部は、断面視において、前記頂辺部と繋がる第 1 の部分と、前記第 1 の部分よりも外側に位置し、前記接着面と繋がる第 2 の部分と、を有しており、前記側部は、断面視において、前記第 1 及び第 2 の部分を通る仮想直線と実質的に一致している、又は、前記仮想直線よりも外側に突出していてもよい。
- [0014] [8] 上記発明において、前記導体パターンは、導電性粒子を含み、前記導電性粒子の平均直径は、前記導体パターンの幅の半分以下であってもよい。
- [0015] [9] 上記発明において、前記導体パターンの幅は、 $1\ \mu\text{m} \sim 5\ \mu\text{m}$ であってもよい。
- [0016] [1 0] 上記発明において、前記他の面側における前記配線体の乱反射率は、前記接着面側における前記配線体の乱反射率に対して相対的に小さくてもよい。
- [0017] [1 1] 本発明に係る配線基板は、上記配線体と、前記配線体を支持する支持体と、を備えることを特徴とする。
- [0018] [1 2] 本発明に係るタッチセンサは、上記配線基板を備えることを特徴とする。
- [0019] [1 3] 本発明に係る配線体の製造方法は、凹版の凹部に導電性材料を充填する第 1 の工程と、前記凹版に充填された前記導電性材料に対して乾燥、加熱及びエネルギー線の照射のうちの少なくとも 1 つを行い、前記導電性材料の上面に凹凸形状を形成する第 2 の工程と、前記凹凸形状に絶縁材を入り込ませる第 3 の工程と、少なくとも前記絶縁材及び前記導電性材料を、前記凹版から離型する第 4 の工程と、を備えたことを特徴とする。
- [0020] [1 4] 上記発明において、前記第 3 の工程は、前記凹凸形状に入り込んだ前記絶縁材の上に基材を配置する工程を含み、前記第 4 の工程は、前記導電性材料が前記絶縁材を介して前記基材に固定された状態で、前記基材、前記絶縁材及び前記導電性材料を、前記凹版から離型する工程であってもよい。

[0021] [15] 上記発明において、下記（２）式を満たしてもよい。

$$0.5 \leq D/C \cdots (2)$$

但し、上記（２）式において、Cは乾燥、加熱及びエネルギー線の照射のうちの少なくとも１つが行われた前記導電性材料の断面視における最大幅であり、Dは加熱又はエネルギー線を照射された前記導電性材料の前記断面視における最大高さである。

[0022] [16] 上記発明において、前記凹部の内壁は、平坦面を含んでもよい。

[0023] [17] 上記発明において、前記平坦面は、前記上面に対して傾斜していてもよい。

[0024] [18] 上記発明において、前記凹部の内面形状は、底面に向かって凸となる面を含んでもよい。

発明の効果

[0025] 本発明によれば、導体パターンにおいて絶縁部材に接着される接着面の面粗さは、当該導体パターンにおいて接着面を除く他の面の面粗さよりも粗くなっている。このため、絶縁部材と導体パターンとを強固に接着しつつ、外部から入射する光の乱反射を抑制することができる。

図面の簡単な説明

[0026] [図1]図1は、本発明の実施形態における配線基板を示す斜視図である。

[図2]図2は、図1のII-II線に沿った断面図である。

[図3]図3は、図1のIII-III線に沿った断面図である。

[図4]図4（A）～図4（C）は、本発明の実施形態における配線体の第1～第3変形例をそれぞれ示す断面図である。

[図5]図5は、本発明の実施形態における導電層を説明するための断面図である。

[図6]図6（A）～図6（E）は、本発明の実施形態における配線基板の製造方法を示す断面図である。

[図7]図7は、本発明の実施形態における配線体の作用を説明するための断面図である。

[図8]図8（A）～図8（E）は、本発明の実施形態における配線体の製造方法の変形例を示す断面図である。

発明を実施するための形態

[0027] 以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。

[0028] 図1は実施形態における配線基板を示す斜視図であり、図2は図1のII-II線に沿った断面図であり、図3は図1のIII-III線に沿った断面図であり、図4（A）～図4（C）は実施形態における配線体の第1～第3変形例をそれぞれ示す断面図である。

[0029] 本実施形態における配線基板10（配線体1）は、タッチパネル等のタッチセンサの電極基材等として用いられるものである。このようなタッチセンサは、たとえば、配線基板10（配線体1）と表示装置（不図示）とを組み合わせ、タッチ位置を検出する機能を有する入力装置として用いられる。表示装置としては、特に限定されず、液晶ディスプレイ、有機ELディスプレイ、電子ペーパー等を用いることができる。

[0030] タッチセンサとしては、たとえば、2つの配線基板10（配線体1）を用いた投影型の静電容量方式のタッチセンサ等があるが、このようなタッチセンサでは、相互に対向配置された2つの配線基板10の一方を検出電極、他方を駆動電極として用い、この2つの電極の間に外部回路（不図示）から所定電圧を周期的に印加している。そして、たとえば、操作者の指（外部導体）が当該タッチセンサに接近すると、この外部導体とタッチセンサとの間でコンデンサ（静電容量）が形成され、2つの電極間の電気的な状態が変化する。タッチセンサは、2つの電極間の電気的な変化に基づいて、操作者の操作位置を検出することができる。

[0031] 配線基板10は、図1に示すように、配線体1と、当該配線体1を支持する基材2と、を備えている。配線体1は、絶縁部材としての接着層3と、導電層4と、を備えている。なお、配線基板10（配線体1）の用途は、特に上記に限定されない。

[0032] 本実施形態において、導電層4は、複数の直線状の導体パターン41によ

って構成されたメッシュ形状（網目形状）を有している。本実施形態では、導体パターン41によって構成される各網目の形状は略正方形とされているが、特にこれに限定されず、各網目の形状が次のような幾何学的模様であってもよい。すなわち、上記網目の形状が、正三角形、二等辺三角形、直角三角形等の三角形でもよいし、平行四辺形、台形等の四角形でもよい。また、網目の形状が、六角形、八角形、十二角形、二十角形等の n 角形や、円、楕円、星型等でもよい。

[0033] このように、種々の図形単位を繰り返して得られる幾何学模様を、当該導電層4の各網目の形状として用いることができる。また、本実施形態では、導体パターン41は、直線状とされているが、線状に延在しているのであれば、特にこれに限定されず、たとえば、曲線状、馬蹄状、ジグザグ線状等にしてもよい。

[0034] なお、導電層4の平面形状は特にこれに限定されない。例えば、メッシュ形状ではなく、直線であってもよいし、導体パターン41が曲線形状であってもよい。また、導体パターン41が平面視において不均一な幅を有していてもよい。

[0035] 基材2は、可視光線が透過可能であると共に、配線体1を支持する透明な基材である。こうした基材2を構成する材料としては、ポリエチレンテレフタレート（PET）、ポリエチレンナフタレート（PEN）、ポリイミド樹脂（PI）、ポリエーテルイミド樹脂（PEI）、ポリカーボネート（PC）、ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）、液晶ポリマー（LCP）、シクロオレフィンポリマー（COP）、シリコン樹脂（SI）、アクリル樹脂、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、グリーンシート、ガラス等を例示できる。この基材2に、易接着層や光学調整層が形成されていてもよい。

[0036] 絶縁部材としての接着層3は、基材2上に導体パターン41を保持するための層であり、例えば、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、ビニル樹脂、シリコン樹脂、フェノール樹脂、ポリイミド樹脂等のUV硬化性樹脂、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、セラミックグリー

ンシート等の絶縁性材料から構成されている。この接着層 3 は、導体パターン 4 1 を支持する支持部 3 1 と、当該支持部 3 1 を除く基材 2 の主面 2 1 を覆う平状部 3 2 と、を有しており、それら支持部 3 1 及び平状部 3 2 は一体的に形成されている。特に限定しないが、平状部 3 2 の厚さは、 $5\mu\text{m}\sim 100\mu\text{m}$ の範囲内で設定することができる。

[0037] 本実施形態における支持部 3 1 の断面形状（導体パターン 4 1 の延在方向に対する断面形状）は、図 2 に示すように、基材 2 から離れる方向（図 2 中の +Z 方向）に向かって幅狭となる形状となっている。また、支持部 3 1 と導体パターン 4 1 との境界は、当該導体パターン 4 1 の下面（接着面）4 2 の凹凸形状に対応した凹凸形状となっている。このような凹凸形状は、導体パターン 4 1 の接着面 4 2 の面粗さに基づいて形成されている。なお、図 3 に示すように、導体パターン 4 1 の延在方向に沿った断面における支持部 3 1 と導体パターン 4 1 との境界も、導体パターン 4 1 の接着面 4 2 の凹凸形状に対応した凹凸形状となっている。接着面 4 2 の面粗さについては、後に詳細に説明する。図 2 及び図 3 においては、本実施形態における配線体 1 を分かり易く説明するために、支持部 3 1 と導体パターン 4 1 との境界の凹凸形状を誇張して示している。

[0038] 平状部 3 2 は、略均一な高さ（厚さ）で基材 2 の主面 2 1 全体に設けられている。この平状部 3 2 の高さは、支持部 3 1 の高さに対して相対的に低くなっている。このため、支持部 3 1 は平状部 3 2 に対して突出しており、当該支持部 3 1 において配線体 1 の剛性が向上している。なお、支持部 3 1 を除いた基材 2 の主面 2 1 の一部のみ平状部 3 2 が形成されていてもよい。また、特に図示しないが、平状部 3 2 の高さが支持部 3 1 の高さと同しくてもよい。また、平状部 3 2 の高さが支持部 3 1 の高さよりも大きくてもよい。

[0039] なお、接着層 3 から平状部 3 2 を省略し、支持部 3 1 のみで接着層 3 を構成してもよい。この場合には、配線体 1 全体の光透過性が向上するため、当該配線体 1 を実装したタッチパネル等における視認性を向上することができる。

る。本実施形態における接着層 3 が本発明の絶縁部材の一例に相当する。

[0040] 導電層 4（導体パターン 4 1）は、例えば、タッチセンサにおける電極や、当該電極と電氣的に接続されている引出配線として機能する層である。このような導電層 4 は、導電性ペーストを塗布して硬化させることで形成されている。この導電層 4 を構成する導電性ペーストの具体例としては、導電性粉末もしくは金属塩が、バインダ樹脂、水もしくは溶剤、および各種添加剤を混合して構成される導電性ペーストを例示することができる。導電性粉末としては、銀、銅、ニッケル、スズ、ビスマス、亜鉛、インジウム、パラジウム等の金属や、グラファイト、カーボンブラック（ファーネスブラック、アセチレンブラック、ケッチェンブラック）、カーボンナノチューブ、カーボンナノファイバ等のカーボン系材料を挙げることができる。金属塩としては、上述の金属の塩を挙げることができる。

[0041] この導電層 4（導体パターン 4 1）に含まれる導電性粒子としては、形成する導体パターン 4 1 の幅に応じて、例えば、 $0.5 \mu\text{m}$ 以上 $2 \mu\text{m}$ 以下の直径 ϕ ($0.5 \leq \phi \leq 2$) を有する導電性粒子を用いることができる。なお、導体パターン 4 1 における電気抵抗値を安定させる観点から、形成する導体パターン 4 1 の幅の半分以下の平均直径 ϕ を有する導電性粒子を用いることが好ましい。また、導電性粉末としてカーボン系材料を用いる場合、BET 法により測定した比表面積が $20 \text{ m}^2/\text{g}$ 以上の粒子を用いることが好ましい。

[0042] 導電層 4（導体パターン 4 1）として、一定以下の比較的小さい電気抵抗値が求められる場合、導電性粉末としては金属材料を用いることが好ましいが、導電層 4（導体パターン 4 1）として、一定以上の比較的大きい電気抵抗値が許容される場合には、導電性粉末としてカーボン系材料を用いることができる。なお、導電性粒子としてカーボン系材料を用いると、メッシュフィルムへのヘイズや全光線反射率を改善させる観点から好ましい。

[0043] 導電性ペーストに含まれるバインダ樹脂としては、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、ビニル樹脂、ウレタン樹脂、フェノール樹脂、

ポリイミド樹脂、シリコン樹脂、フッ素樹脂等を例示することができる。
導電性ペーストに含まれる溶剤としては、 α -テルピネオール、ブチルカルビ
トールアセテート、ブチルカルビトール、1-デカノール、ブチルセルソル
ブ、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、テトラデカン等
を例示することができる。なお、導電層4を構成する材料からバインダ樹脂
を省略してもよい。

[0044] 導体パターン41の幅としては、50nm~1000 μ mであることが好
ましく、500nm~150 μ mであることがより好ましく、1 μ m~10
 μ mであることがさらに好ましく、1 μ m~5 μ mであることがさらにより
好ましい。また、導体パターン41の高さとしては、50nm~3000 μ
mであることが好ましく、500nm~450 μ mであることがより好まし
く、500nm~10 μ mであることがさらに好ましい。

[0045] 本実施形態の導体パターン41は、接着面42と、頂辺部43と、2つの
側部44、44と、を有している。頂辺部43は、導体パターン41におい
て接着面42の反対側に位置している。この頂辺部43は、基材2の主面2
1（接着層3の平状部32の上面）に対して実質的に平行となっている。

[0046] 頂辺部43は、導体パターン41の幅方向の断面において、平坦部431
を含んでいる。この平坦部431は、導体パターン41の幅方向の断面にお
いて、直線状とされた部分（すなわち、曲率半径が極めて大きい部分）であ
り、平面度が0.5 μ m以下となっている。なお、平面度は、JIS法（J
IS B0621（1984））により測定することができる。

[0047] 本実施形態では、平坦部431の平面度は、レーザ光を用いた非接触式の
測定方法を用いて求める。具体的には、帯状のレーザ光を測定対象（たと
えば頂辺部43や側部44）に照射し、その反射光を撮像素子（たとえば、2
次元CMOS）上に結像させて平面度を測定する。平面度の算出方法は、対
象の平面において、できるだけ離れた3点を通る平面をそれぞれ設定し
、それらの偏差の最大値を平面度として算出する方法（最大ふれ式平面度）
を用いる。なお、平面度の測定方法や算出方法は、特に上述に限定されない

。たとえば、平面度の測定方法は、ダイヤルゲージ等を用いた接触式の測定方法であってもよい。また、平面度の算出方法は、対象となる平面を、平行な平面ではさんだときにできる隙間の値を平面度として算出する方法（最大傾斜式平面度）を用いてもよい。

[0048] 本実施形態の平坦部431は、頂辺部43の略全体に形成されている。なお、特に上述に限定されず、平坦部は、頂辺部の一部に形成されていてもよい。この場合、たとえば、平坦部が頂辺部43の両端を含まない領域に形成されていてもよい。平坦部が頂辺部の一部に形成される場合、当該平坦部431の幅は、頂辺部43の幅に対して少なくとも1/2以上となっている。

[0049] 側部44は、接着面42と頂辺部43との間に位置している。この側部44は、頂辺部43と繋がる第1の部分44aと、接着面42と繋がる第2の部分44bと、を有している。第2の部分44bは、第1の部分44aよりも外側に位置している。

[0050] 仮想直線L（図2中一点鎖線にて表示）は、導体パターン41の幅方向の断面において、第1及び第2の部分44a、44bを通る直線である。この仮想直線Lは、接着層3から離れるに従い、導体パターン41の幅方向の断面における中心に接近するように傾斜している。

[0051] 本実施形態の側部44は、この仮想直線Lと実質的に一致するように延在している。つまり、側部44も、接着層3から離れるに従い、導体パターン41の断面形状における中心に接近するように傾斜している。一の導体パターン41における2つの側部44、44の傾斜角度は、実質的に同一となっている。

[0052] このような側部44は、導体パターン41の幅方向の断面において、平坦部441を含んでいる。平坦部441は、導体パターン41の幅方向の断面において、直線状とされた部分（すなわち、曲率半径が極めて大きい部分）であり、平面度が0.5 μm 以下となっている。本実施形態では、側部44のうち仮想直線Lと実質的に一致して延在する部分が、平坦部441を構成している。すなわち、側部44の略全体に平坦部441が形成されている。

[0053] なお、側部44の形状は、特に上述に限定されない。たとえば、側部44は、導体パターン41の幅方向の断面において、仮想直線Lよりも外側に突出していてもよい。つまり、側部44は、導体パターン41の幅方向の断面において、仮想直線Lよりも内側に凹んでいない形状（導体パターンの裾が広がらない形状）であることが好ましい。また、本実施形態では、平坦部441は、側部44の全体に形成されているが、特にこれに限定されず、当該側部44の一部に形成されていてもよい。

[0054] 導体パターン41の側部44と接着層3における支持部31の側部311とは、滑らかに連続することにより1つの平面を形成している。この場合、支持部31の側部311は、導体パターン41の幅方向の断面において、当該支持部31の裾が広がらない形状であることが好ましい。具体的には、側部311と側部44とが繋がる部分と、側部311と平伏部32とが繋がる部分と、を通る仮想直線よりも、側部311が内側に凹んでいない形状であることが好ましい。

[0055] 導電層4を構成する導体パターン41の断面形状は、図2に示すように略台形形状であるが、特にこれに限定されない。例えば、導体パターン41の断面形状が正形状、長形状等であってもよい。

[0056] また、例えば、導体パターン41の断面形状が、図4（A）に示すように、頂辺部43と側部44、及び頂辺部43と側部44との間に形成された第2の側部45を有していてもよい。第2の側部45は、導体パターン41の断面形状における中心線Cに向かって側部44よりも傾斜して形成されている。本実施形態では、この第2の側部45は、第2の側部45と頂辺部43とが繋がる第3の部分45aと、側部44と第2の側部45とが繋がる第4の部分45bとを通る仮想直線L2と実質的に一致して延在している。この場合、側部44の第1の部分44aと、第2の側部45の第4の部分45bとは実質的に一致している。そして、このような第2の側部45も、側部44と同様、導体パターン41の幅方向の断面において、仮想直線L2よりも内側に凹んでいない形状（導体パターンの裾が広がらない形状）であること

が好ましい。また、図4（B）に示すように、導体パターン41の断面形状が頂辺部43を有しておらず、左右の側部44同士が頂点441で繋がっていてもよい。また、図4（C）に示すように、導体パターン41における下面（接着面）42を除く他の面が、基材2から離れる方向に向かって凸状に形成された曲面46を含んでいてもよい。なお、図4（A）～図4（C）の例では導体パターン41の断面形状が左右対称の形状となっているが、当該断面形状が左右非対称の形状であってもよい。

[0057] 本実施形態において、導体パターン41の側部44は、接着面42（平均面）に対して所定角度で傾斜している。導体パターン41の頂辺部43は、上述のとおり基材2の主面21（接着層3の平状部32の上面）に対して実質的に平行となっている。この場合、側部44と頂辺部43との間の角度 θ は、側部44における光の乱反射を抑制する観点から、 $90^{\circ} \sim 170^{\circ}$ （ $90^{\circ} \leq \theta \leq 170^{\circ}$ ）であることが好ましく、 $90^{\circ} \sim 120^{\circ}$ （ $90^{\circ} \leq \theta \leq 120^{\circ}$ ）であることがより好ましい。本実施形態では、側部44の一方と頂辺部43との間の角度と、側部44の他方と頂辺部43との間の角度とは、実質的に同一となっている。

[0058] また、本実施形態では、下記（3）式が成立している。

$$0.5 \leq B/A \cdots (3)$$

但し、上記（3）式において、Aは導体パターン41の断面視における最大幅であり、Bは導体パターン41の当該断面視における最大高さ（厚さ）である。なお、上記（3）式の B/A は、3以下（ $B/A \leq 3$ ）であることが好ましい。

[0059] また、本実施形態の導体パターン41では、頂辺部43が平坦部431（平滑面）を含んでおり、接着面42の面粗さは、当該平坦部431を含む頂辺部43の面粗さよりも粗くなっている。具体的には、導体パターン41の接着面42の面粗さ R_a が $0.1 \mu m \sim 3 \mu m$ 程度であるのに対し、頂辺部43の面粗さ R_a は $0.001 \mu m \sim 1.0 \mu m$ 程度となっている。この場合、接着面42の面粗さと、頂辺部43の面粗さとの比（接着面42の面粗

さに対する頂辺部43の面粗さ)は、 $0.01 \sim 1$ 未満となっている。なお、接着面42の面粗さ R_a は $0.1 \sim 0.5 \mu m$ であることが好ましく、頂辺部43の面粗さ R_a は $0.001 \mu m \sim 0.3 \mu m$ であることが好ましい。また、頂辺部43の面粗さは、導体パターン41の幅(最大幅A)の5分の1以下であることが好ましい。また、接着面42の面粗さと、頂辺部43の面粗さとの比は、 $0.1 \sim 1$ 未満であることが好ましい。

[0060] このような面粗さは、JIS法(JIS B0601(2013年3月21日改正))により測定することができる。接着面42の面粗さ及び頂辺部43の面粗さの測定は、導体パターン41における幅方向に沿って行ってもよい(図2参照)、導体パターン41における延在方向に沿って行ってもよい(図3参照)。

[0061] 因みに、JIS法(JIS B0601(2013年3月21日改正))に記載されるように、ここでの「面粗さ R_a 」とは「算術平均粗さ R_a 」のことをいう。この「算術平均粗さ R_a 」とは、断面曲線から長波長成分(うねり成分)を遮断して求められる粗さパラメータのことをいう。断面曲線からのうねり成分の分離は、形体を求めるのに必要な測定条件(たとえば、当該対象物の寸法等)に基づいて行われる。

[0062] また、本実施形態では、側部44も平坦部441を含んでいる。そして、頂辺部43と同様、接着面42の面粗さは、平坦部441を含む側部44の面粗さよりも粗くなっている。具体的には、上述の接着面42の面粗さ R_a に対して、側部44の面粗さ R_a は $0.001 \mu m \sim 1.0 \mu m$ 程度となっている。なお、側部44の面粗さ R_a は $0.001 \mu m \sim 0.3 \mu m$ であることが好ましい。側部44の面粗さの測定は、導体パターン41における幅方向に沿って行ってもよい(図2参照)、導体パターン41における延在方向に沿って行ってもよい(図3参照)。

[0063] 頂辺部43が平坦部431を含み、側部44が平坦部441を含んでいることで、接着面42を除く他の面側(すなわち、頂辺部43及び側部44を含む面側)における配線体1の乱反射率が、接着面42側における配線体1

の乱反射率に対して相対的に小さくなっている。具体的には、接着面42側における配線体1の乱反射率と接着面42を除く他の面側における配線体1の乱反射率との比（接着面42側における配線体1の乱反射率に対する接着面42を除く他の面側における配線体1の乱反射率）が0.1～1未満となっており、0.3～1未満であることが好ましい。

[0064] 上述した接着面と他の面との面粗さの相対的關係を有する導体パターン41Bの形状の一例について、図5を参照しながら説明する。図5に示すように、導電性粒子Mとバインダ樹脂Bとを含み構成される導体パターン41Bでは、複数の導電性粒子Mがバインダ樹脂B中に分散している。そして、導体パターン41Bの幅方向の断面において、接着面42Bでは、導電性粒子Mの一部がバインダ樹脂Bから突出しており、これにより、当該接着面42Bが凹凸形状となっている。一方、導体パターン41Bの幅方向の断面において、頂辺部43B及び側部44Bでは、導電性粒子M同士の間にはバインダ樹脂Bが入り込み、バインダ樹脂Bが導電性粒子Mを覆っている。これにより、頂辺部43Bに平坦部431Bが形成されている。また、側部44Bに平坦部441Bが形成されている。なお、頂辺部43B及び側部44Bにおいて、導電性粒子がバインダ樹脂により覆われていることで、隣り合う導体パターン41同士の間における電気絶縁性が向上し、マイグレーションの発生が抑制される。

[0065] 図5に示す形態では、接着面42Bにおいて導電性粒子Mの一部がバインダ樹脂Bから突出していることで、当該接着面42Bの面粗さが比較的大きくなっている。一方、頂辺部43Bにおいては、バインダ樹脂Bにより導電性粒子Mが覆われていることで、当該頂辺部43Bの面粗さが比較的小さくなっている。これにより、接着面42Bの面粗さが頂辺部43Bの面粗さよりも粗くなっている。

[0066] また、側部44Bにおいても、頂辺部43Bと同様、バインダ樹脂Bにより導電性粒子Mが覆われていることで、当該側部44Bの面粗さが比較的小さくなっている。これにより、接着面42Bの面粗さが側部44Bの面粗さ

よりも粗くなっている。なお、接着面、頂辺部、及び側部の形状は、上述の面粗さの相対的關係を有していれば、図5に示す形態に限定されない。

[0067] 次に、本実施形態における配線基板10の製造方法について説明する。図6(A)～図6(E)は、本実施形態における配線基板の製造方法を説明するための断面図である。

[0068] まず、図6(A)に示すように、導電層4のメッシュ形状に対応する形状の凹部51が形成された凹版5を準備する。凹版5を構成する材料としては、ニッケル、シリコン、二酸化珪素などガラス類、セラミック類、有機シリカ類、グラッシーカーボン、熱可塑性樹脂、光硬化性樹脂等を例示することができる。

[0069] このような凹部51の幅としては、50nm～1000 μ mであることが好ましく、500nm～150 μ mであることがより好ましく、1 μ m～10 μ mであることがさらに好ましく、1 μ m～5 μ mであることがさらにより好ましい。また、凹部51の高さとしては、50nm～3000 μ mであることが好ましく、500nm～450 μ mであることがより好ましく、500nm～10 μ mであることがさらに好ましい。

[0070] 本実施形態における凹部51の内壁52は平坦面になっていると共に、当該内壁52は凹部51の底面53に向かって幅狭となるよう傾斜している（図6(A)の引き出し図参照）。凹部51を含む凹版5の表面には、離型性を向上するために黒鉛系材料、シリコン系材料、フッ素系材料、セラミック系材料、アルミニウム系材料等からなる離型層を形成することが好ましい。

[0071] 上記の凹版5の凹部51に対し、導電性材料6を充填する（第1の工程）。このような導電性材料6としては、上述したような導電性ペーストを用いる。また、加熱されることにより導電性が付与される材料を用いてもよい。導電性材料6を凹版5の凹部51に充填する方法としては、例えばディスペンス法、インクジェット法、スクリーン印刷法を挙げることができる。もしくはスリットコート法、バーコート法、ブレードコート法、ディップコート

法、スプレーコート法、スピンコート法での塗工の後に凹部以外に塗工された導電性材料をふき取るもしくは掻き取る、吸い取る、貼り取る、洗い流す、吹き飛ばす方法を挙げることができる。導電性材料の組成等、凹版の形状等に応じて適宜使い分けることができる。

[0072] 次に、図6（B）に示すように、凹版5の凹部51に充填された導電性材料6を加熱することにより導電層4を構成する導体パターン41を形成する。導電性材料6の加熱条件は、導電性材料6の組成等に応じて適宜設定することができる。

[0073] この加熱処理により、導電性材料6が体積収縮する。この際、導電性材料6の上面47を除く外面は、凹部51の内壁52及び底面53に沿った平坦面を有する形状に形成される。一方、凹部51に充填された導電性材料6の上面47は、外部雰囲気と接触した状態で加熱される。このため、導体パターン41の上面47には、導電性材料6に含まれる導電性粒子の形状に基づく凹凸形状が形成される（第2の工程）。導電性材料6は、本工程において加熱硬化するため、後の工程で凹版5の凹部51から取り出しても濡れ広がりを生じない。なお、導電性材料の処理方法は加熱に限定されない。赤外線、紫外線、レーザー光等のエネルギー線を照射しても良いし、乾燥のみでもよい。また、これらの2種以上の処理方法を組合せても良い。

[0074] また、この際、下記（4）式が成立している。

$$0.5 \leq D/C \cdots (4)$$

但し、上記（4）式において、Cは加熱された導電性材料6の断面視における最大幅であり、Dは加熱された導電性材料6の当該断面視における最大高さ（厚さ）である（図4（Bの引き出し図参照）。なお、上記（4）式の D/C は、3以下（ $D/C \leq 3$ ）であることが好ましい。

[0075] 続いて、図6（C）に示すように、接着層3を形成するための接着性材料7を凹版5上に塗布する。このような接着性材料7としては、上述した接着層3を構成する材料を用いる。接着性材料7を凹版5上に塗布する方法としては、スクリーン印刷法、スプレーコート法、バーコート法、ディップ法、

インクジェット法等を例示することができる。この塗布により、導体パターン 4 1 の凹凸形状を含む凹部 5 1 内に接着性材料 7 が入り込む（第 3 の工程）。

[0076] 続いて、図 6（D）に示すように、凹版 5 上に塗布された接着性材料 7 の上から基材 2 を配置する。この配置は、接着性材料 7 と基材 2 との間に気泡が入り込むことを抑制するために、真空下で行うことが好ましい。基材の材料は上述したものを例示できる。これら基材は易接着層や光学調整層が形成されていても良い。次いで、接着性材料 7 を固める。接着材料を固める方法としては、紫外線、赤外線レーザー光等のエネルギー線照射、加熱、加熱冷却、乾燥等を例示することができる。これにより、接着層 3 が形成されると共に、当該接着層 3 を介して基材 2 と導体パターン 4 1 とが相互に接着され固定される。

[0077] なお、本実施形態では、接着性材料 7 を凹版 5 上に塗布した後に基材 2 を積層しているが、特にこれに限定されない。例えば、基材 2 の主面（凹版 5 に対向する面）に予め接着性材料 7 を塗布したものを凹版 5 上に配置することにより、接着性材料 7 を介して基材 2 を凹版 5 に積層してもよい。

[0078] 次いで、基材 2、接着層 3 及び導電層 4 を離型し（第 4 の工程）、配線基板 1 0（配線体 1）を得ることができる（図 6（E）参照）。なお、図 4（A）～図 4（C）に示す配線体については、それぞれの導体パターン 4 1 及び支持部 3 1 の形状に応じた凹部を有する凹版を用いることにより、上記と同様にして製造することができる。

[0079] 次に、本実施形態における配線体 1 及びその製造方法の作用について説明する。図 7 は、本実施形態における配線体の作用を説明するための断面図である。

[0080] 本実施形態の配線体 1 では、導体パターン 4 1 における接着面 4 2 と当該接着面 4 2 以外の他の面（頂辺部 4 3 及び側部 4 4 を含む面）との面粗さ（すなわち、うねり成分を遮断した粗さパラメータ）の相対的關係に着目しており、当該接着面 4 2 の面粗さ R_a を他の面の面粗さ R_a に対して相対的に

粗くしている。このため、接着層 3 と導体パターン 4 1 とを強固に接着しつつ、外部から入射する光の乱反射を抑制することができる。特に、導体パターン 4 1 の幅が $1\ \mu\text{m}$ ～ $5\ \mu\text{m}$ の場合に、接着面 4 2 と他の面との面粗さの相対的關係が上述の關係を満たすことで、接着層 3 と導体パターン 4 1 とを強固に接着しつつ、外部から入射する光の乱反射を抑制することができるという効果を顕著に奏することができる。

[0081] また、本実施形態における配線体 1 を製造する際は、上述したように、凹版 5 の凹部 5 1 に導電性材料 6 を充填した後に当該導電性材料 6 を加熱する。これにより、加熱後の導電性材料 6 の底面は、凹部 5 1 の底面 5 3 の平坦面に対応して平坦状な部分を含んでいる。このため、導電層 4 を構成する導体パターン 4 1 の頂辺部 4 3 は、平坦部 4 3 1 を含む。これにより、配線体 1 をタッチパネルの電極基材等として用いた際、当該配線体 1 の外部から入射する光の乱反射をさらに抑制することができる。この結果、配線体 1 を実装したタッチパネル等の視認性を向上することができる。

[0082] 同様に、本実施形態では、加熱後の導電性材料 6 の側面は、凹部 5 1 の内壁 5 2 の平坦面に対応して平坦状な部分を含んでいる。このため、導電層 4 を構成する導体パターン 4 1 の側部 4 4 は、平坦部 4 4 1 を含む。これにより、配線体 1 をタッチパネルの電極基材等として用いた際、当該配線体 1 の外部から入射する光の乱反射をさらに抑制することができる。この結果、配線体 1 を実装したタッチパネル等の視認性をさらに向上することができる。

[0083] また、図 7 に示すように、配線体 1 をタッチパネル等に使用する際、樹脂材料等からなるコート層 8 を導体パターン 4 1 の周囲に設ける場合には、導体パターン 4 1 の頂辺部 4 3 が平坦部 4 3 1 を含むことにより、当該導体パターン 4 1 の表面付近に気泡が形成され難くなる。これにより、配線体 1 をタッチパネルの電極基材等として用いた際、配線体 1 の外部から入射する光が当該気泡で乱反射することを抑制できる。このため、配線体 1 を実装したタッチパネル等の視認性をより向上することができる。また、導体パターン 4 1 の表面付近に気泡が形成され難くなることにより、当該気泡内に存在す

る水分によって導体パターン41が腐食してしまうことを抑制することができる。

[0084] 同様に、導体パターン41の側部44が平坦部441を含むことにより、当該導体パターン41の表面付近に気泡が形成され難くなる。これにより、配線体1をタッチパネルの電極基材等として用いた際、配線体1の外部から入射する光が当該気泡で乱反射することを抑制できる。このため、配線体1を実装したタッチパネル等の視認性をより向上することができる。また、導体パターン41の表面付近に気泡が形成され難くなることにより、当該気泡内に存在する水分によって導体パターン41が腐食してしまうことを抑制することができる。

[0085] また、図7に示す配線体1では、コート層8側の外部から当該配線体1の内部に入射する光が導電層4の側部44で反射しても、反射光がコート層8側から外部に漏れ出ることがほぼ無くなる。このような配線体1をタッチパネル等を実装することで、当該タッチパネル等の視認性をさらに向上することができる。

[0086] なお、導体パターン41の幅方向における断面形状において、頂辺部43が平坦部431を含む場合には、コート層8の外表面81を平坦状に形成し易くなる。これにより、当該コート層8の外表面81にフィルム（不図示）を設ける場合には、コート層8の外表面81によって当該フィルムを安定保持しつつ、フィルムの歪みの発生を抑制することができる。

[0087] また、本実施形態では、側部44は、第1及び第2の部分44a、44bを通る仮想直線Lと実質的に一致するように延在している。この場合、導体パターンの幅方向の断面において、側部が仮想直線よりも内側に凹んだ形状（導体パターンの裾が広がる形状）となっていないため、配線体1の外部から入射する光の乱反射が抑えられる。このような配線体1をタッチパネル等を実装することで、当該タッチパネル等の視認性をさらに向上することができる。

[0088] また、本実施形態では、接着面42の面粗さRaを接着面42以外の他の

面（頂辺部43及び側部44を含む面）の面粗さ R_a に対して相対的に粗くしていることで、当該他の面側における配線体1の乱反射率が、接着面42側における配線体1の乱反射率に対して相対的に小さくなっている。ここで、配線体1の乱反射率が小さいと、導体パターン41が白く映るのを抑え、当該導体パターン41を視認できる領域においてコントラストの低下を抑制することができる。このように、本実施形態の配線体1を実装したタッチパネル等の視認性のさらなる向上を図ることができる。

[0089] また、本実施形態の配線体1の製造時において、加熱後の導電性材料6の上面47には、導電性材料6に含まれる導電性粒子の形状に基づく凹凸形状が形成される。すなわち、導電層4を構成する導体パターン41の下面（接着面）42には凹凸形状が形成される。この凹凸形状により、導体パターン41と接着層3との間の接触面積を増大し、当該導体パターン41と接着層3とを強固に接着することができる。一方、導体パターン41と凹版5との間の接触面は平坦状となっている。このため、導体パターン41を凹版5から離型する際の離型性を向上することができる。本実施形態では、凹版5の凹部51の内壁52が、導電性材料6（導電層4）の上面47（接着面42）に対して傾斜しており、当該凹部51が底面53に向かって幅狭となっているため、この効果をより向上することができる。なお、凹部51の内壁52が上記のように傾斜していることは、導電性材料6を充填する際（図4（A）参照）の充填性の向上にも寄与する。

[0090] また、導体パターン41と接着層3とを強固に接着することができることにより、配線体1の湾曲や屈曲により当該導体パターン41が接着層3から剥がれることを抑制できるため、配線体1の耐久性を向上することができる。

[0091] さらに、導体パターン41を凹版5から離型する際の離型性が向上する効果により、加熱後の導電性材料6（導体パターン41）の断面形状を、上記（3）式及び（4）式を満たす形状とすることが可能となる。これにより、導体パターン41の断面積を増大させ、当該導体パターン41の単位長さ当

たりの電氣的抵抗値を低減することができる。なお、この効果は、 $B/A \leq 3$ 及び $D/C \leq 3$ である場合においてより向上する。

[0092] 上述した効果は、導体パターン 4 1 が図 4 (A) ~ 図 4 (C) に示すような形状である場合においても同様に奏することができる。

[0093] なお、以上に説明した実施形態は、本発明の理解を容易にするために記載されたものであって、本発明を限定するために記載されたものではない。したがって、上記の実施形態に開示された各要素は、本発明の技術的範囲に属する全ての設計変更や均等物をも含む趣旨である。

[0094] 例えば、図 8 (A) ~ 図 8 (E) に示すような製造方法により、配線体 1 B を製造してもよい。具体的には、凹版 5 に導電性材料 6 を充填して加熱した後 (図 8 (A)、図 8 (B))、接着性材料 7 B を凹版 5 上に塗布し (図 8 (C))、当該接着性材料 7 B を固める (図 8 (D))。そして、固めた当該接着性材料 7 B (接着体 7 1) を基材として用い、加熱後の導電性材料 6 (導体パターン 4 1) 及び接着体 7 1 を凹版 5 から離型することにより、配線体 1 B を製造することができる。このようにして製造した配線体 1 B においても、上述した配線体 1 と同様の効果を奏することができる。

[0095] また、上述の実施形態のタッチセンサは、2つの配線基板 1 0 (配線体 1) を用いた投影型の静電容量方式のタッチセンサであるが、特にこれに限定されず、1つの配線基板 (配線体) を用いた表面型 (容量結合型) 静電容量方式のタッチセンサにも、本発明を適用することができる。

[0096] また、導電層 4 (導体パターン) の導電性粉末として、金属材料とカーボン系材料を混合したものを用いてもよい。この場合、たとえば、導体パターンの頂辺部側にカーボン系材料を配置し、接着面側に金属系材料を配置してもよい。また、その逆で、導体パターンの頂辺部側に金属系材料を配置し、接着面側にカーボン系材料を配置してもよい。

[0097] また、特に図示しないが、上述した実施形態における配線体 1 から基材 2 を省略しておいてもよい。この場合において、例えば、接着層 3 の下面に剥離シートを設け、実装時に当該剥離シートを剥がして実装対象 (フィルム、

表面ガラス、偏光板、ディスプレイガラス等）に接着して実装する形態として配線体を構成してもよい。また、絶縁部材側から配線体 1 を覆う樹脂部をさらに設け、当該樹脂部を介して、上述の実装対象に接着して実装する形態としてもよい。また、導電層 4 側から配線体 1 を覆う樹脂部を設け、当該樹脂部を介して、上述の実装対象に接着して実装する形態としてもよい。これらの場合、配線体を実装する実装対象が本発明の支持体の一例に相当する。

[0098] さらに、上述の実施形態では、配線体は、タッチセンサ等に用いられるとして説明したが、特にこれに限定されない。たとえば、配線体に通電して抵抗加熱等で発熱させることにより当該配線体をヒーターとして用いてもよい。この場合、導電層（導体パターン）の導電性粉末としては、比較的電気抵抗値の高いカーボン系材料を用いることが好ましい。また、配線体の導電部の一部を接地することにより当該配線体を電磁遮蔽シールドとして用いてもよい。また、配線体をアンテナとして用いてもよい。この場合、配線体を実装する実装対象が本発明の支持体の一例に相当する。

符号の説明

[0099] 1 0 . . . 配線基板

1、1 B . . . 配線体

2 . . . 基材

3 . . . 接着層

3 1 . . . 支持部

3 2 . . . 平状部

4 . . . 導伝層

4 1 . . . 導体パターン

4 2 . . . 下面（接着面）

4 3 . . . 頂辺部

4 3 1 . . . 平坦部

4 4 . . . 側部

4 4 a, 4 4 b . . . 第 1 及び第 2 の部分

4 4 1 . . . 平坦部

4 5 . . . 第 2 の側部

4 6 . . . 曲面

4 7 . . . 上面

5 . . . 凹版

5 1 . . . 凹部

5 2 . . . 内壁

5 3 . . . 底面

6 . . . 導電性材料

7、7 B . . . 接着性材料

請求の範囲

- [請求項1] 絶縁部材と、
前記絶縁部材に接着される導体パターンと、を備え、
前記導体パターンにおいて前記絶縁部材に接着される接着面の面粗さは、前記導体パターンにおいて前記接着面を除く他の面の面粗さよりも粗いことを特徴とする配線体。
- [請求項2] 請求項1に記載の配線体であって、
下記(1)式を満たすことを特徴とする配線体。
$$0.5 \leq B/A \cdots (1)$$

但し、上記(1)式において、Aは前記導体パターンの断面視における最大幅であり、Bは前記導体パターンの前記断面視における最大高さである。
- [請求項3] 請求項1又は2に記載の配線体であって、
前記他の面は、前記接着面の反対側に位置する頂辺部を有し、
前記頂辺部は、平坦部を含むことを特徴とする配線体。
- [請求項4] 請求項1～3の何れか1項に記載の配線体であって、
前記他の面は、
前記接着面の反対側に位置する頂辺部と、
前記接着面と前記頂辺部との間に位置する側部を有し、
前記側部は、断面視において、前記絶縁部材から離れる方向に従い、前記導体パターンの中心に接近するように傾斜していることを特徴とする配線体。
- [請求項5] 請求項4に記載の配線体であって、
前記頂辺部と前記側部との間の角度 θ は、 $90^\circ \sim 120^\circ$ であることを特徴とする配線体。
- [請求項6] 請求項4又は5に記載の配線体であって、
前記側部は、断面視において、
前記頂辺部と繋がる第1の部分と、

前記第 1 の部分よりも外側に位置し、前記接着面と繋がる第 2 の部分と、を有しており、

前記側部は、断面視において、前記第 1 及び第 2 の部分を通る仮想直線と実質的に一致している、又は、前記仮想直線よりも外側に突出していることを特徴とする配線体。

[請求項7] 請求項 1 ～ 6 の何れか 1 項に記載の配線体であって、
前記導体パターンは、導電性粒子を含み、
前記導電性粒子の平均直径は、前記導体パターンの幅の半分以下であることを特徴とする配線体。

[請求項8] 請求項 1 ～ 7 の何れか 1 項に記載の配線体であって、
前記導体パターンの幅は、 $1\ \mu\text{m}$ ～ $5\ \mu\text{m}$ であることを特徴とする配線体。

[請求項9] 請求項 1 ～ 8 のいずれか一項に記載の配線体であって、
前記他の面側における前記配線体の乱反射率は、前記接着面側における前記配線体の乱反射率に対して相対的に小さいことを特徴とする配線体。

[請求項10] 請求項 1 ～ 9 の何れか 1 項に記載の配線体と、
前記配線体を支持する支持体と、を備えることを特徴とする配線基板。

[請求項11] 請求項 10 に記載の配線基板を備えることを特徴とするタッチセンサ。

[請求項12] 凹版の凹部に導電性材料を充填する第 1 の工程と、
前記凹版に充填された前記導電性材料に対して乾燥、加熱及びエネルギー線の照射のうちの少なくとも 1 つを行い、前記導電性材料の上面に凹凸形状を形成する第 2 の工程と、
前記凹凸形状に絶縁材を入り込ませる第 3 の工程と、
少なくとも前記絶縁材及び前記導電性材料を、前記凹版から離型する第 4 の工程と、を備えたことを特徴とする配線体の製造方法。

[請求項13]

請求項 1 2 に記載の配線体の製造方法であって、

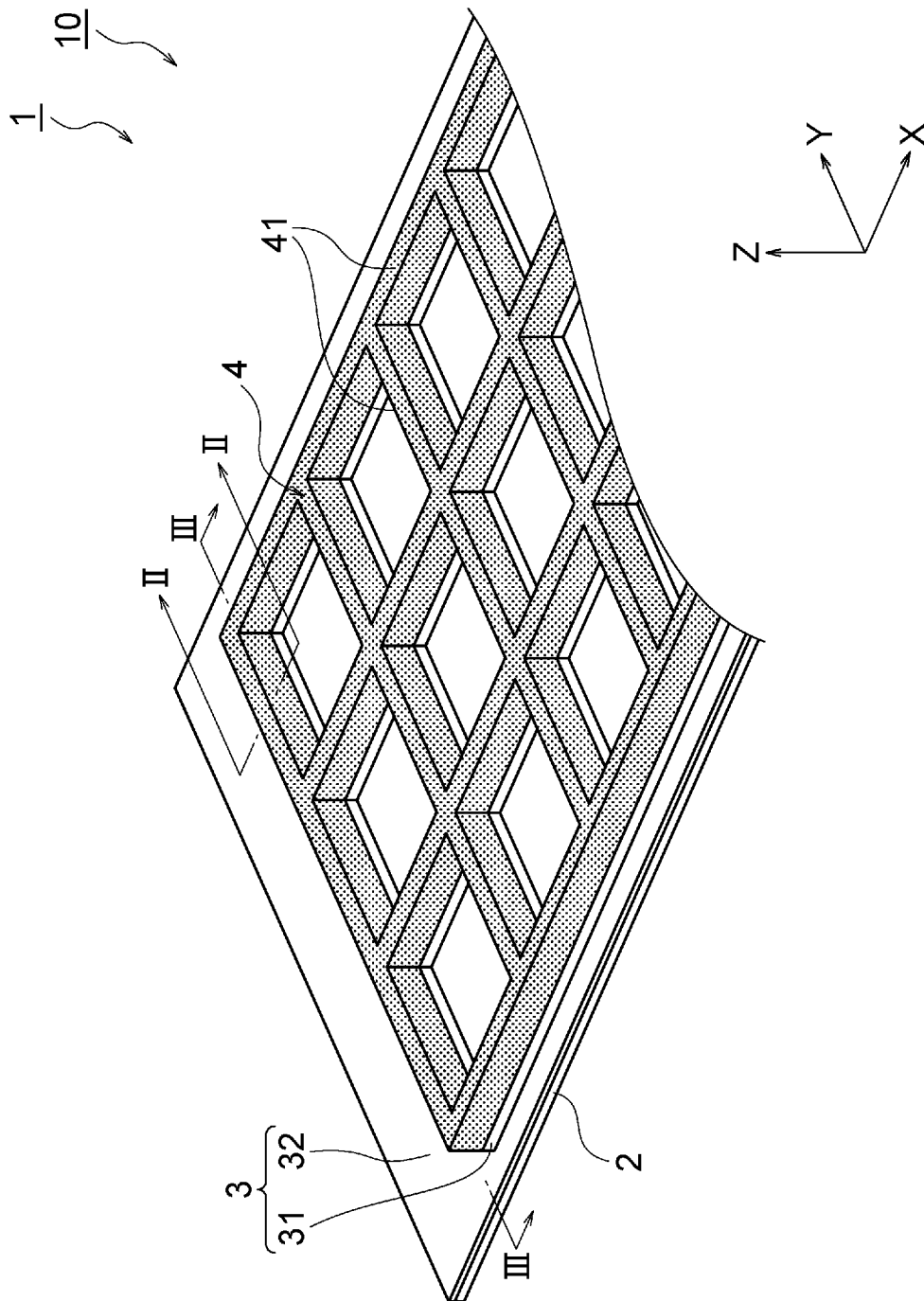
前記第 3 の工程は、前記凹凸形状に入り込んだ前記絶縁材の上に基材を配置する工程を含み、

前記第 4 の工程は、前記導電性材料が前記絶縁材を介して前記基材に固定された状態で、前記基材、前記絶縁材及び前記導電性材料を、前記凹版から離型する工程であることを特徴とする配線体の製造方法

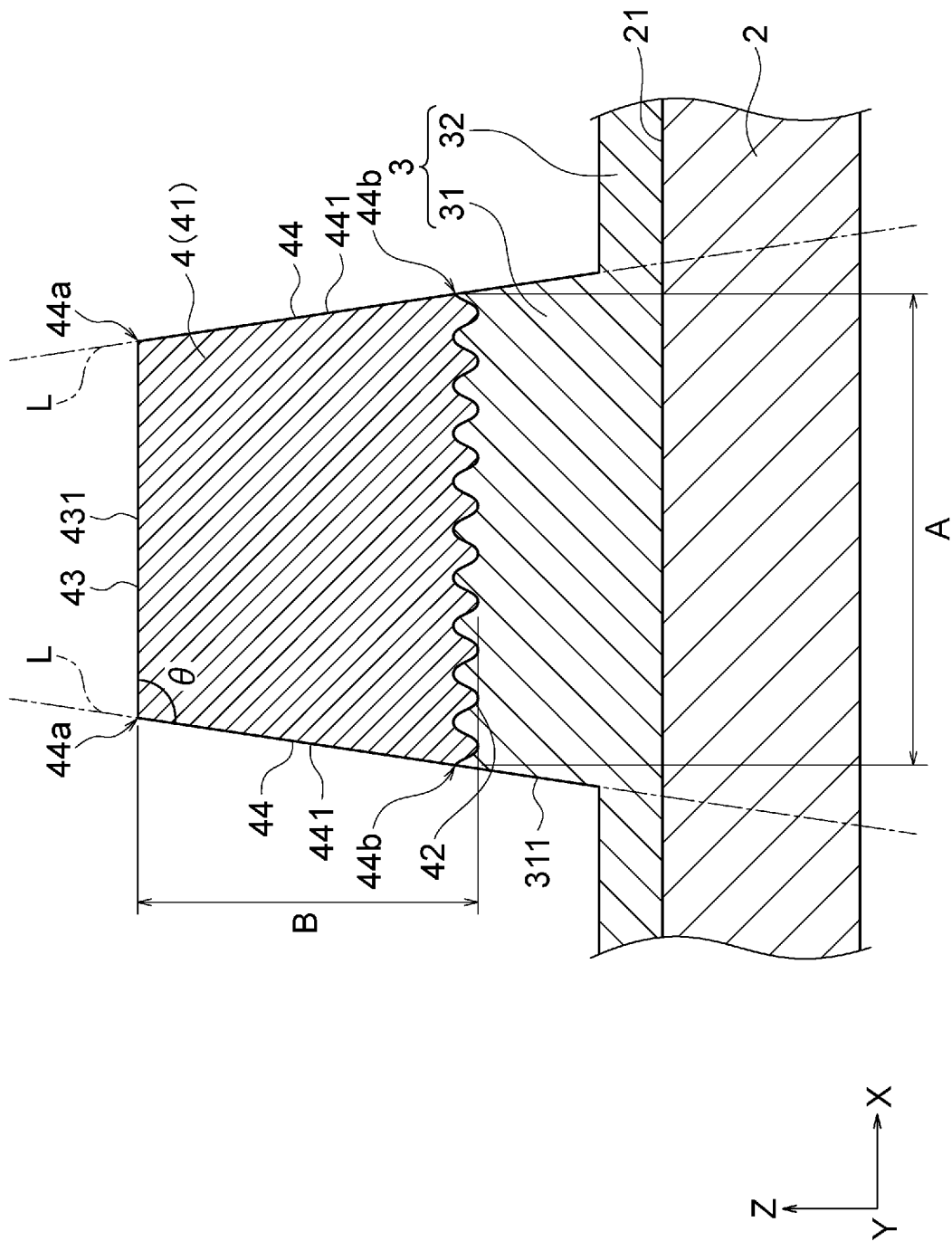
。

[図1]

1

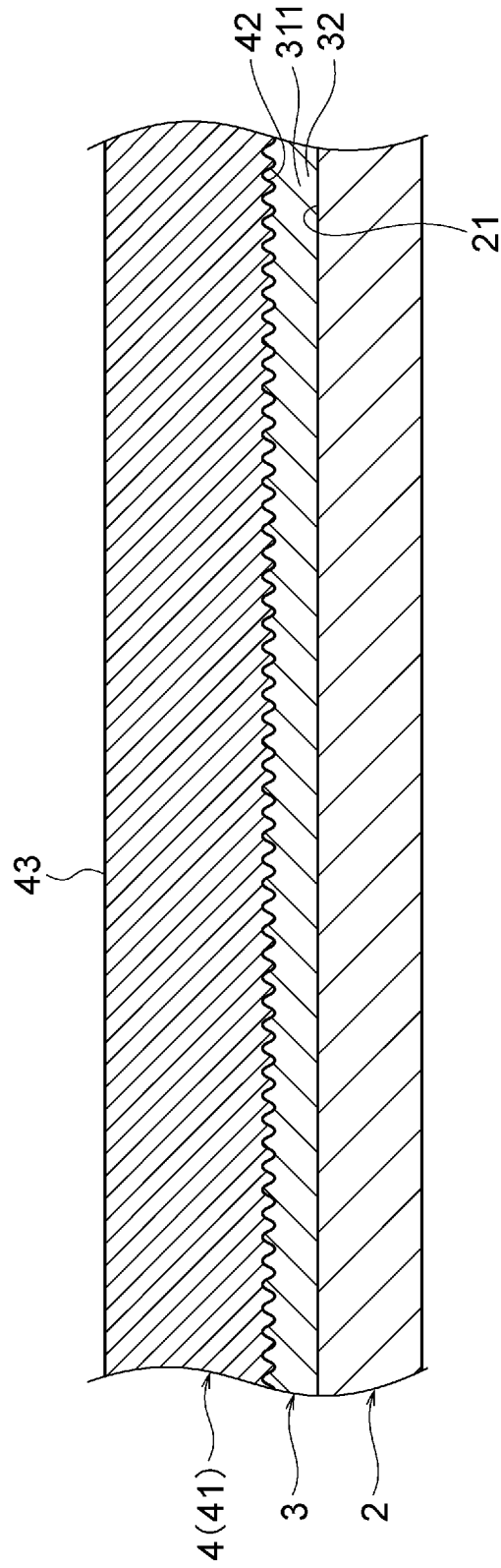


[図2]

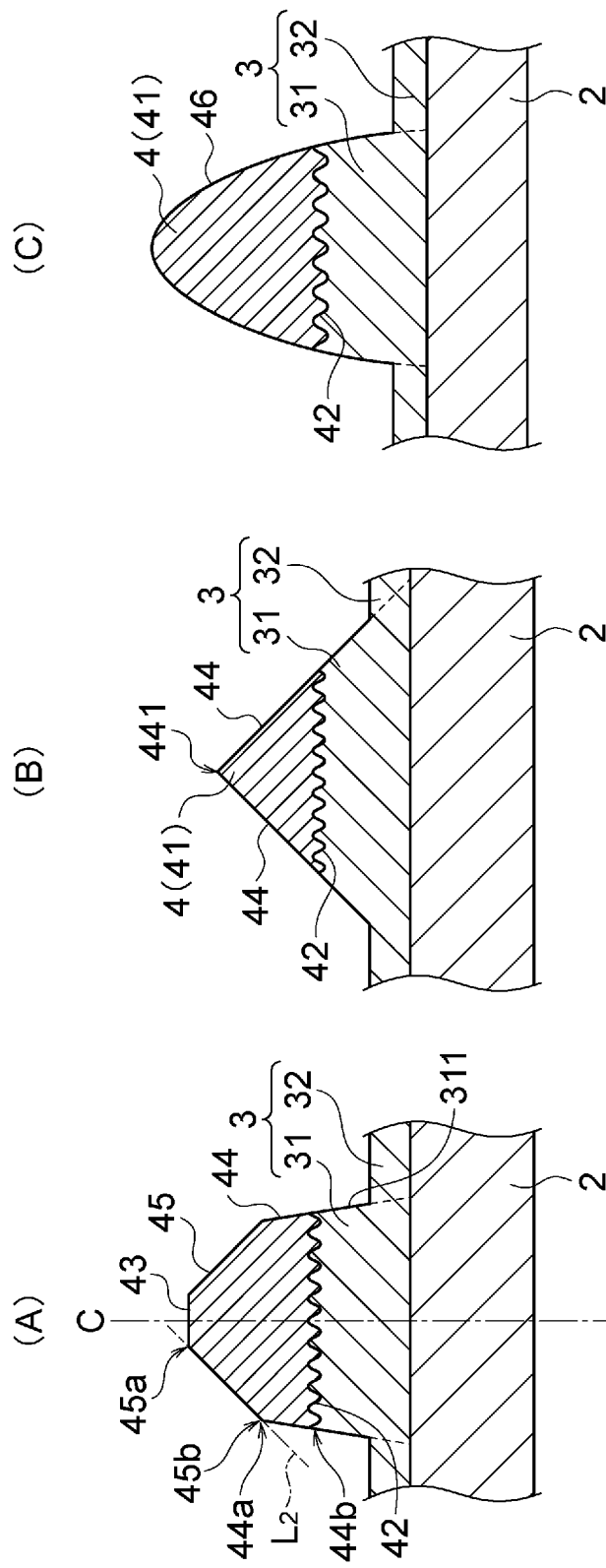
 2


[図3]

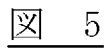
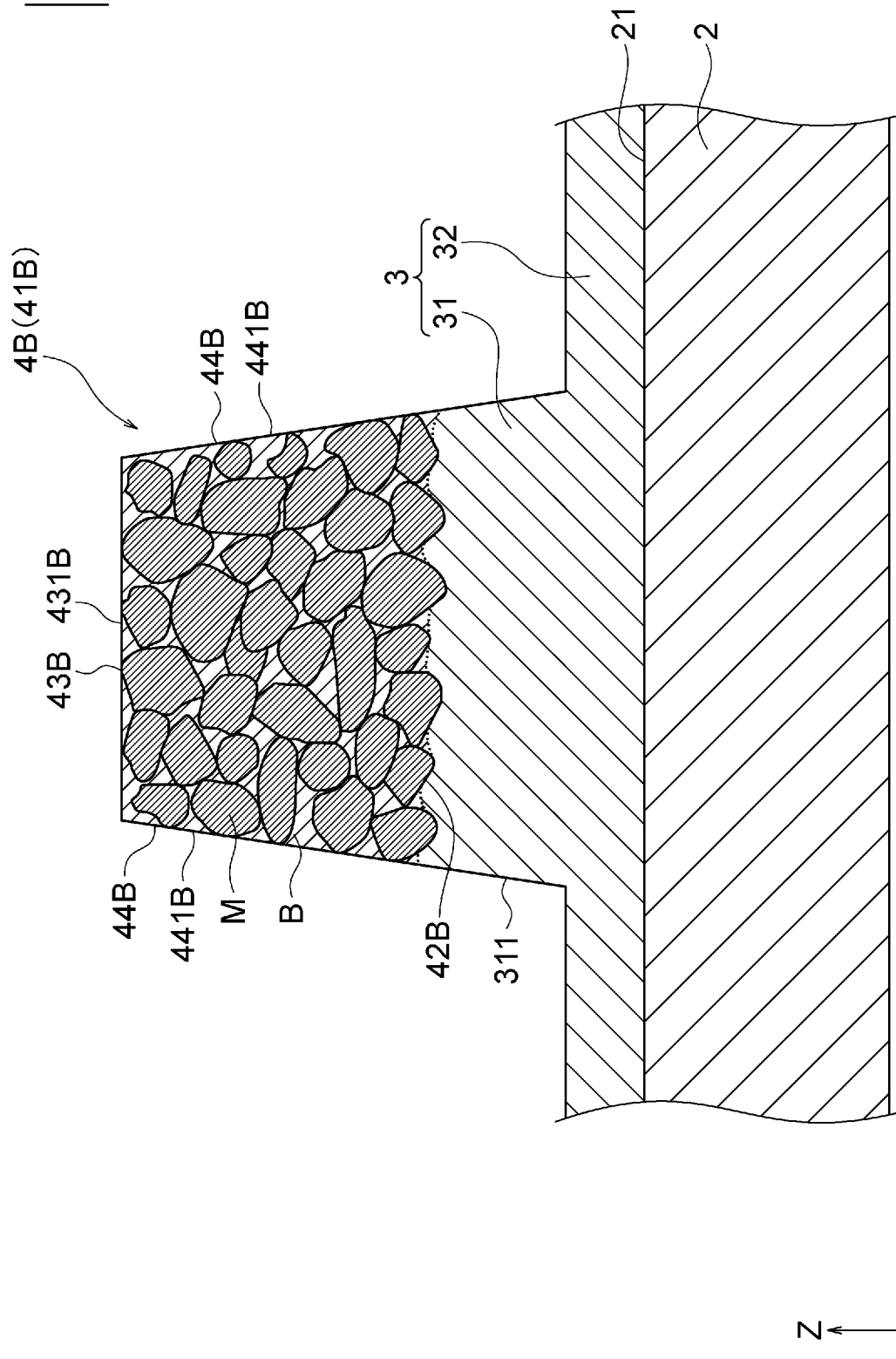
3



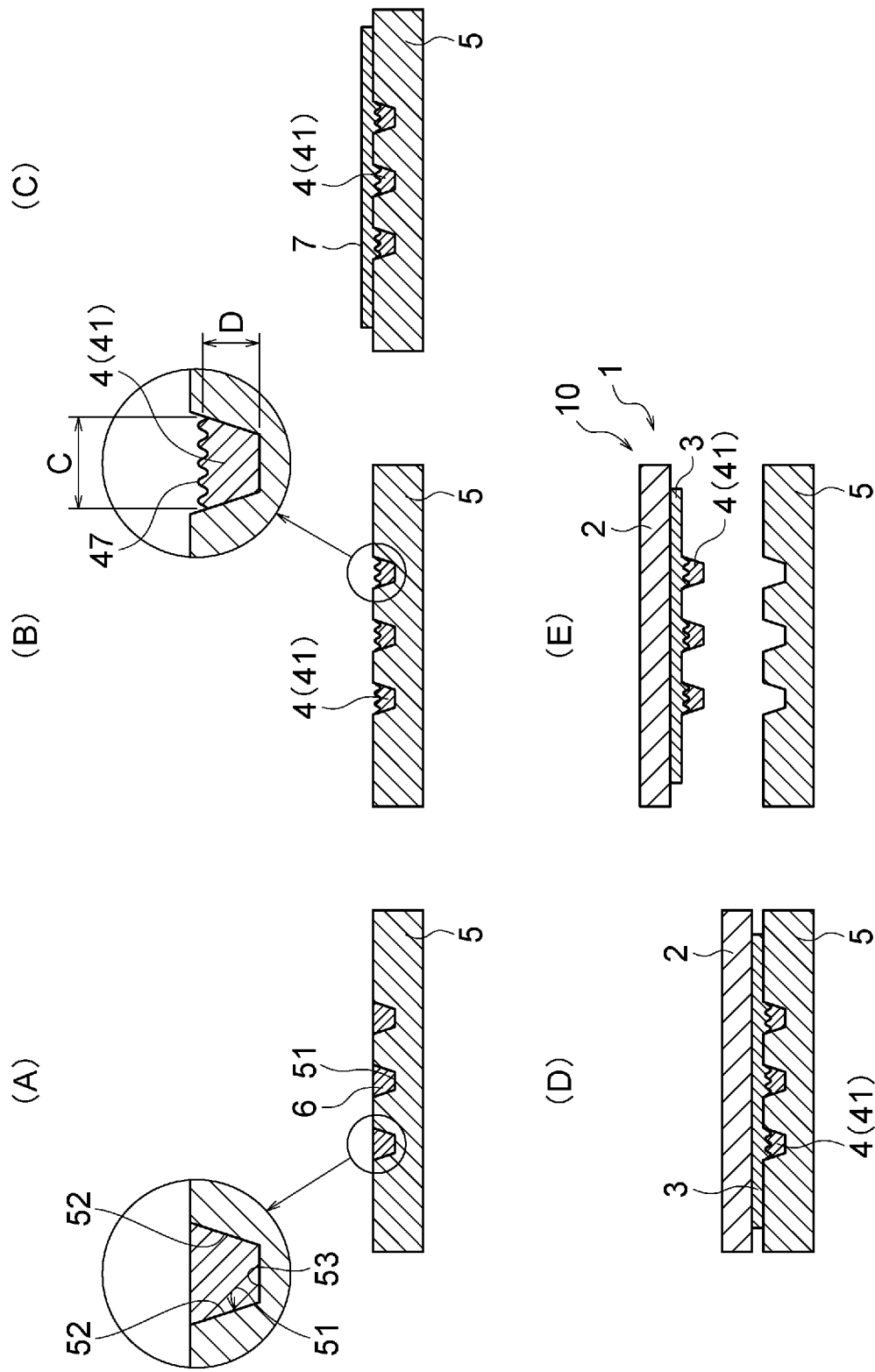
[図4]

 4


[図5]

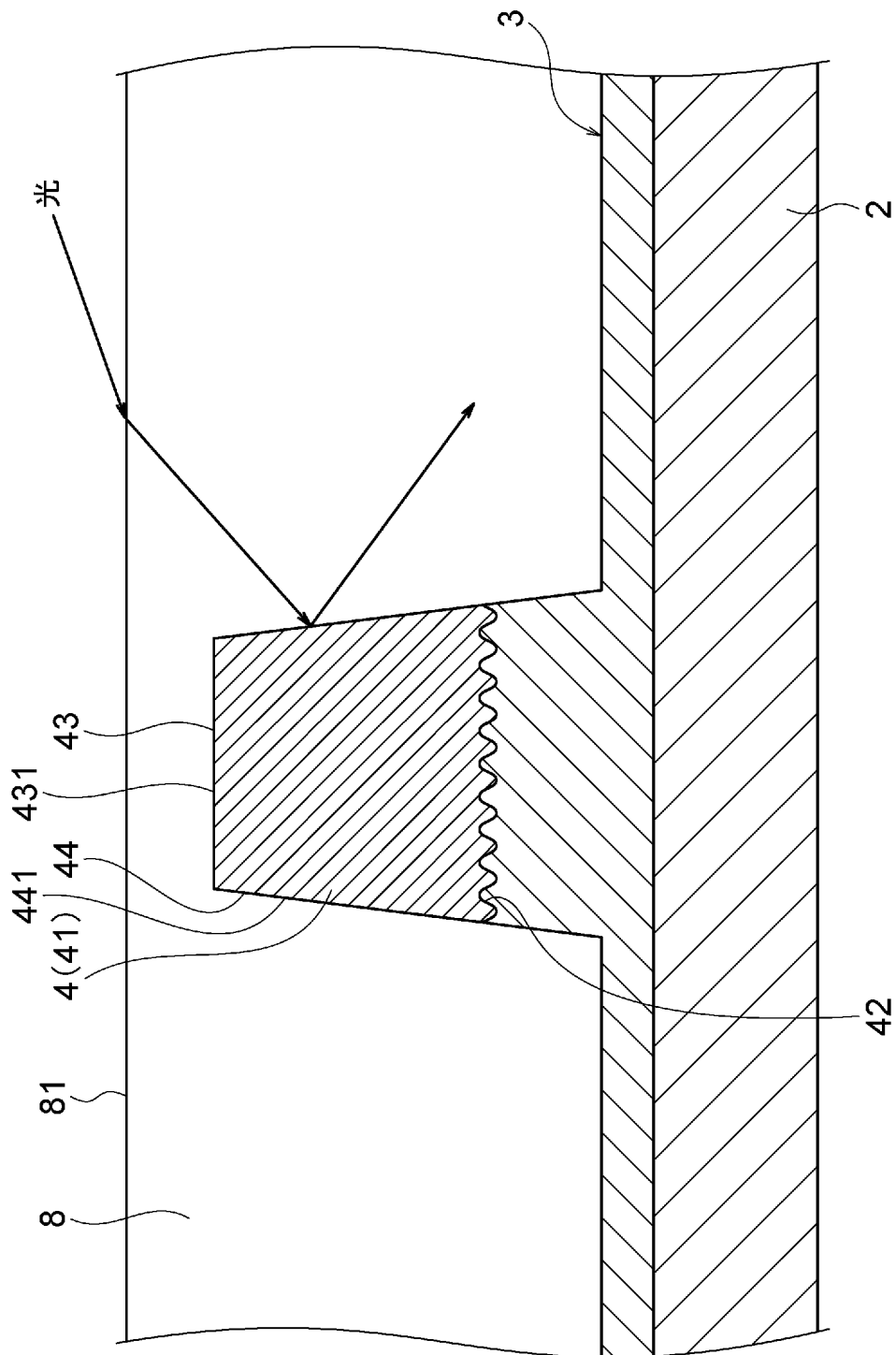
 5


[図6]

 6


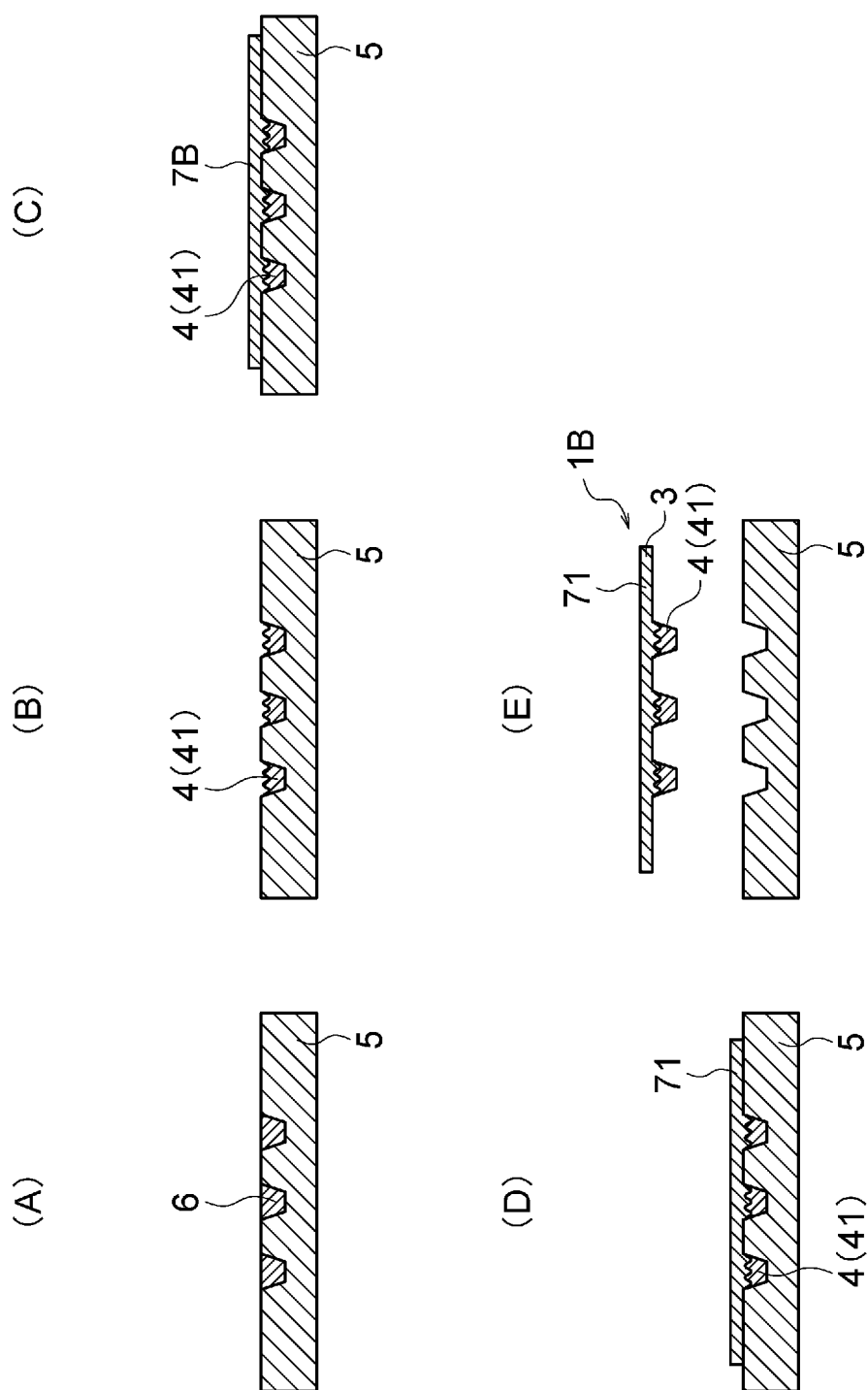
[図7]

図 7



[図8]

8



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2015/086271

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G06F3/041(2006.01)i, H05K3/12(2006.01)i, H05K3/20(2006.01)i, H05K3/38(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G06F3/041, H05K3/12, H05K3/20, H05K3/38

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2016
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2016	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2016

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	JP 7-169635 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 04 July 1995 (04.07.1995), paragraphs [0042], [0052] to [0073] & JP 2000-200730 A & JP 2000-200728 A & JP 2000-200729 A & US 5609704 A & US 6310304 B1 & US 6378424 B1 column 5, line 39; column 7, line 26 to column 11, line 11	1-6, 9-13 7, 8
X Y	JP 4-240792 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 28 August 1992 (28.08.1992), paragraphs [0001], [0011], [0024], [0026] & US 5201268 A column 3, lines 11 to 26	1-3, 9-13 7, 8

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
01 March 2016 (01.03.16)

Date of mailing of the international search report
15 March 2016 (15.03.16)

Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2015/086271

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2012-185813 A (Fujifilm Corp.), 27 September 2012 (27.09.2012), paragraph [0076] & US 2014/0054070 A1 paragraph [0198] & WO 2012/111819 A1	7, 8
Y	JP 2011-139097 A (Brother Industries, Ltd.), 14 July 2011 (14.07.2011), paragraphs [0025], [0047] & JP 2006-332615 A & JP 2011-129957 A & JP 2011-129958 A & JP 2011-129959 A & US 2006/0237229 A1 & US 2011/0185566 A1 paragraphs [0026], [0069] & EP 1720389 A2	7, 8

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. G06F3/041(2006.01)i, H05K3/12(2006.01)i, H05K3/20(2006.01)i, H05K3/38(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. G06F3/041, H05K3/12, H05K3/20, H05K3/38

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2016年
日本国実用新案登録公報	1996-2016年
日本国登録実用新案公報	1994-2016年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X Y	JP 7-169635 A（松下電器産業株式会社）1995.07.04, 第42、52-73 段落 & JP 2000-200730 A & JP 2000-200728 A & JP 2000-200729 A & US 5609704 A & US 6310304 B1 & US 6378424 B1, 第5欄39行, 第 7欄26行-第11欄11行	1-6, 9-13 7, 8
X Y	JP 4-240792 A（松下電器産業株式会社）1992.08.28, 第1、11、24、 26段落 & US 5201268 A, 第3欄11-26行	1-3, 9-13 7, 8

☑ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

01.03.2016

国際調査報告の発送日

15.03.2016

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁（ISA/J P）

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

加内 慎也

5 E

9745

電話番号 03-3581-1101 内線 3521

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 2012-185813 A (富士フイルム株式会社) 2012. 09. 27, 第 76 段落 & US 2014/0054070 A1, [0198] & WO 2012/111819 A1	7, 8
Y	JP 2011-139097 A (ブラザー工業株式会社) 2011. 07. 14, 第 25、47 段落 & JP 2006-332615 A & JP 2011-129957 A & JP 2011-129958 A & JP 2011-129959 A & US 2006/0237229 A1 & US 2011/0185566 A1, [0026] [0069] & EP 1720389 A2	7, 8